

## СТИМУЛИРОВАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕХОД МОТТА В ПРЯМОЗОННОМ ПОЛУПРОВОДНИКЕ

*В. С. Днепровский, В. И. Клинов, М. Г. Новиков*

Зарегистрировано изменение запаздывания импульса стимулированного излучения в CdSe (80 K) от 30 – 40 пс при высоких до 0,6 – 1 нс при низких уровнях возбуждения ультракороткими импульсами света, которое объяснено изменением механизма рекомбинации – переходом от электронно-дырочной плазмы к экситонам высокой плотности.

В сильно возбужденных полупроводниках вследствие экранирования кулоновского взаимодействия происходит переход Мотта от слабо ионизованного экситонного газа к сильноионизованной электронно-дырочной плазме. (ЭДП). При уменьшении концентрации ЭДП, происходящей в результате рекомбинации и диффузии, наблюдается обратный переход от ЭДП к экситонам. Многочисленные попытки обнаружить переход Мотта по изменению спектров люминесценции прямозонных полупроводников  $A_2B_6$  не удались из-за того, что спектры излучения плотного экситонного газа и ЭДП практически совпадают и сильно искажены усилением. Появление в спектрах отражения особенностей, характерных для экситонов<sup>1</sup> (проведены одновременные измерения кинетики спектров люминесценции и отражения), может быть и не связано с переходом Мотта, т. к. похожая структура спектра отражения может возникать при распаде ЭДП<sup>2</sup>. Не удалось наблюдать и скачок фототока, определяемый переходом Мотта от экситонов к ЭДП<sup>3</sup>.

В настоящей работе исследована люминесценция пластинчатых моно кристаллов CdSe (80 K) толщиной 40 – 50 мкм при межзонном возбуждении ультракороткими импульсами (УКИ) излучения второй гармоники неодимового лазера с длительностью , не превышающей 10 пс, и максимальной энергией  $W = 2,5 \text{ мкДж}$ . Луч лазера направлялся под углом 45° к поверхности образцов и фокусировался в пятно диаметром 0,1 мм. Кинетические измерения проводились с помощью скоростного фотоэлектронного регистратора (СФР) АГАТ-СФ (разрешение до 5 пс). На щель спектрографа и СФР одновременно с изображением возбуждаемой области проецировалось изображение торца кристалла, рассеивающего излучение усиленной люминесценции. Для определения времени разгорания люминесценции и запаздывания импульсов стимулированного излучения на вход СФР одновременно направлялись опорные импульсы отраженного от кристалла излучения накачки.

При  $W = 0,04 - 0,8 \text{ мкДж}$  в излучении из возбуждаемой области доминировала (рис. 1) широкая  $Q$ -полоса (690 нм). Трек усиленной люминесценции появлялся при  $W > 0,2 \text{ мкДж}$ . Полоса индуцированной люминесценции  $R'$  (702 нм) разгоралась на длинноволновом крыле  $Q$ -полосы. В случае максимальных накачек вклад стимулированной люминесценции ( $R$ -полоса) становился заметен и в излучении из возбуждаемой области.

В случае, когда накачка была ниже порога развития стимулированных процессов, максимум импульса люминесценции из возбуждаемого объема (рис. 2б) был задержан на 0,6 нс относительно УКИ. С увеличением  $W$  до 0,2 мкДж зарегистрирован импульс стимулированного излучения, время запаздывания которого  $\Delta t = 0,9 \text{ нс}$  (рис. 2в). На вершине импульса излучения из возбуждаемого объема при этом появлялся короткий всплеск связанный, по-видимому, с индуцированной люминесценцией (всплеск возникал одновременно с коротким импульсом усиленного излучения). При  $W > 0,4 \text{ мкДж}$  задержка импульсов излучения как из области возбуждения, так и с торца образца резко сокращалась (рис. 2г), при максимальных накачках  $\Delta t \approx 30 - 40 \text{ пс}$  (вставка на рис. 2). Несущественные изменения спектров люминесценции при изменении уровня возбуждения на первый взгляд позволяют предположить,

что во всем диапазоне мощностей накачки, использованных в работе, развивается лишь один механизм рекомбинации, связанный с распадом ЭДП. Такому выводу противоречат результаты измерений задержек импульса стимулированного излучения относительно УКИ накачки, которые сильно различались при высоких ( $\Delta t_1 = 30 - 40$  пс) и низких ( $\Delta t_2 = 0,6 - 0,9$  нс) уровнях возбуждения, что указывало на развитие по крайней мере двух механизмов рекомбинации: рекомбинации ЭДП и плотного экситонного газа. Задержка в 30 – 40 пс, по-видимому, связана со временем остыния ЭДП от исходной температуры, определяемой избыточной энергией носителей в 0,53 эВ, до температуры, при которой усиление в ЭДП преобладает над потерями. Сравнительно медленное для полярных полупроводников остыние ЭДП может быть связано с неравновесным заполнением LO-фононных мод и экранированием электрон-фононного взаимодействия<sup>4, 5</sup>. Процессы быстрого диффузационного расширения<sup>6</sup>

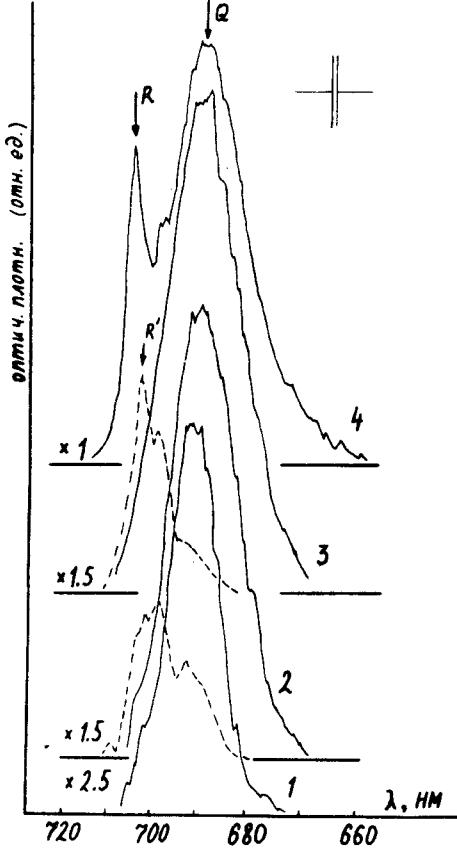


Рис. 1

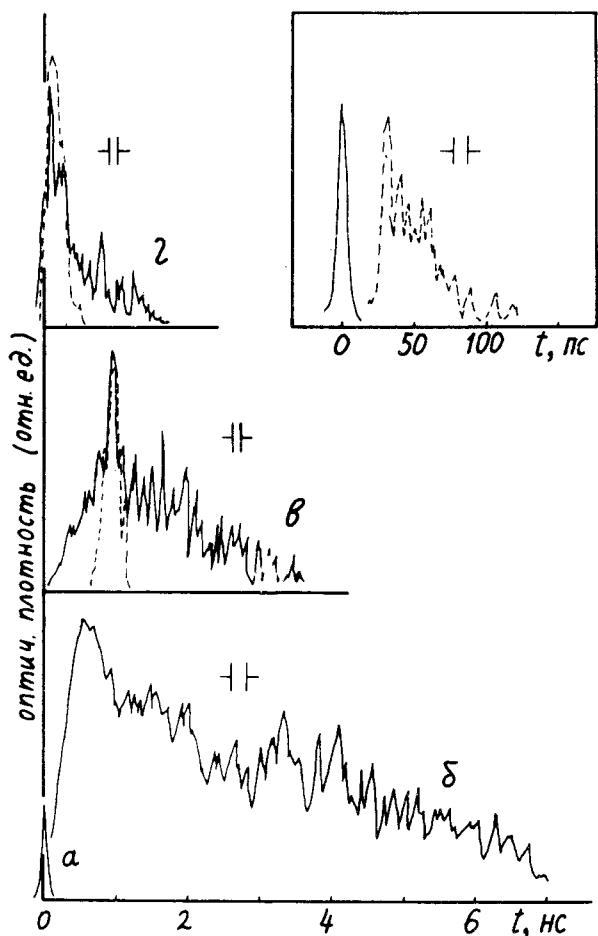


Рис. 2

Рис. 1. Денситограммы спектров излучения CdSe (80 К) из возбуждаемого объема (сплошная линия) и излучения усиленной люминесценции, рассеиваемого на торце кристалла (штрих) при различной энергии УКИ накачки ( $W$ ): 1 –  $0,05 W_0$ ; 2 –  $0,3 W_0$ ; 3 –  $0,42 W_0$ ; 4 –  $W_0$ ;  $W_0 = 0,8$  мкДж

Рис. 2. Денситограммы импульса возбуждения (a), импульсов излучения CdSe (80 К) из возбуждаемого объема (сплошная линия) и излучения усиленной люминесценции, рассеиваемого на торце кристалла (штрих) при различной энергии УКИ возбуждения ( $W$ ): б –  $0,08$  мкДж, в –  $0,28$  мкДж; г –  $0,44$  мкДж; вставка –  $0,8$  мкДж

и рекомбинации приводят к понижению концентрации  $n_e$  ЭДП. При  $n_e < n_M$  ( $n_M$  – концентрация моттовского перехода ЭДП – газ экситонов) становится возможным образование экситонов. Задержка  $\Delta t_2$  при этом определяется временем, необходимым для накопления такого количества экситонов, которое достаточно для развития стимулированных процессов в экситонной системе. Замедление связывания в экситоны можно объяснить экранирующим влиянием ЭДП. На это указывает сокращение времени нарастания интенсивности люминесценции с уменьшением уровня возбуждения (рис. 3). В отсутствие экранирования сечение связывания носителей в экситоны  $\sigma_0$  не зависит от  $n_e$ , и характерное время связывания  $\tau = (\sigma_0 v_t n_e)^{-1}$  ( $v_t$  – тепловая скорость носителей) увеличивается с падением концентрации. Влияние экранирования на эффективность электрон-дырочного взаимодействия учитывалось введением зависящей от  $n_e$  диэлектрической проницаемости:  $\epsilon \sim [1 - n_e/n_M]^{-1}$ .

При этом  $\sigma = \sigma_0 [1 - n_e/n_M]^{3/2}$  ( $\sigma \sim 1/\epsilon^{3/2}$ ). Проведено численное интегрирование двух связанных кинетических уравнений для концентраций носителей и экситонов. Экспериментальные результаты по измерению времени нарастания интенсивности люминесценции совпадают с рассчитанными значениями при  $\sigma_0 = 0,6 \cdot 10^{-13} \text{ см}^2$  (рис. 3).

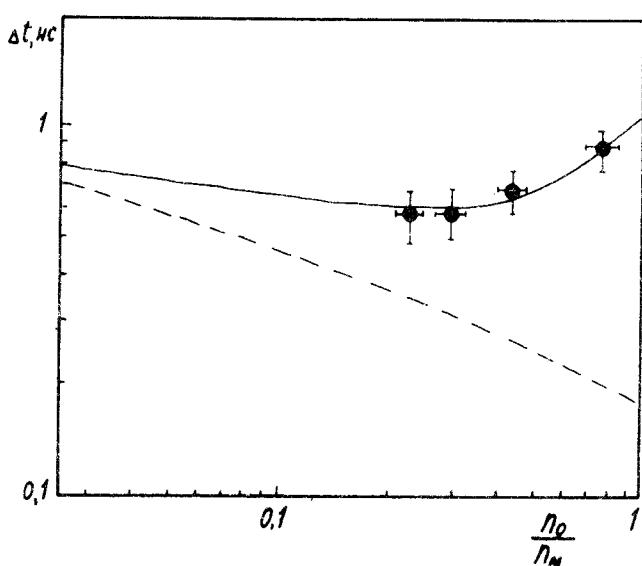


Рис. 3. Зависимость времени запаздывания  $\Delta t$  максимума интенсивности экситонной люминесценции от начальной концентрации фотовозбужденных носителей  $n_0$  ( $n_0 \sim \sim W$ ) без учета (штрих), с учетом экранирования (сплошная линия) и экспериментальные результаты

Переходу ЭДП – газ экситонов соответствует такая концентрация носителей при которой перенормированный край зоны проводимости совпадает с экситонным уровнем <sup>8</sup>. В случае прямой рекомбинации линии спонтанного и стимулированного излучения ЭДП должны располагаться по энергии вблизи экситонного перехода, что противоречит результатам эксперимента ( $Q, R, R'$  – полосы люминесценции были значительно более длинноволновыми). Можно предположить, что при рекомбинации ЭДП доминируют не прямые переходы, а переходы с испусканием  $LO$ -фононов (плазмон-фононным смешиванием при  $n_e \sim 10^{17} \text{ см}^{-3}$  можно пренебречь). Отношение вероятностей непрямой ( $W^i$ ) и прямой ( $W^d$ ) рекомбинации электрона в вырожденной ЭДП:

$$\frac{W^i}{W^d} = \frac{2}{\pi} \frac{e^2}{\hbar \omega_{LO}} \left[ \frac{1}{\epsilon_\infty} - \frac{1}{\epsilon_0} \right] (k_F + k_F) \geq \frac{2}{\pi} \frac{e^2}{\hbar \omega_{LO}} \left[ \frac{1}{\epsilon_\infty} - \frac{1}{\epsilon_0} \right] k_F \geq 0,3,$$

при  $n_e \geqslant 10^{17} \text{ см}^{-3}$  ( $k$  – волновой вектор электрона,  $k_F$  – фермиевский волновой вектор,  $\epsilon_0$  и  $\epsilon_\infty$  – статическая и высокочастотная диэлектрическая проницаемость). Роль переходов с участием  $LO$ -фононов возрастает в случае невырожденной ЭДП, когда излучение, соответствующее прямым переходам, ослабляется за счет перепоглощения в возбуждаемом объеме.

В заключение отметим, что аналогичные результаты по изменению запаздывания стимулированного излучения получены в CdS (80 K) при возбуждении УКИ излучения третьей гармоники неодимового лазера.

#### Литература

1. *Unuma Y. et al.* Phys. St. Sol. (b), 1984, **125**, 735.
2. *Schwizer H. et al.* Phys. Rev. Lett., 1983, **51**, 698.
3. *Egorov V.D. et al.* Sol. St. Comm., 1981, **38**, 271.
4. *Балтрамеюнас Р. и др.* ЖЭТФ, 1986, **91**, 1909.
5. *Junnarkar M.R., Alfano R.R.* Phys. Rev. B, 1986, **34**, 7045.
6. *Majumder F.A. et al.* Phys. Rev. B, 1985, **32**, 2407.
7. *Абакумов В.Н. и др.* ЖЭТФ, 1980, **78**, 1240.
8. *Zimmerman R.* Phys. St. Sol. (b), 1988, **146**, 371.

Московский государственный университет  
им. М.В.Ломоносова

Поступила в редакцию  
29 января 1990 г.